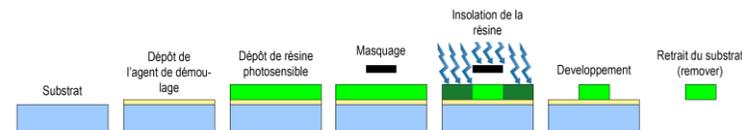


Equipements	Caractéristiques	Utilisations
Lithographie par faisceau d'électrons Raith Pioneer e-line	- Taille échantillon max 2" - Platine interférométrique laser - Déplacement max 50 x 50 mm - Résolution 20 nm - Tension max 30 keV	- Nanofabrication (écriture à l'échelle nanométrique)
Lithographie UV SUSS MicroTec MJB4	Résolution max : 400 nm Taille d'échantillon : wafer 2" Alignement optique : +/- 1µm Transfert de motifs dans la plage allant du micro au nanomètre	Impression de microstructures
Evaporateur thermique ou par faisceau d'électrons Plassys MEB 400	Taille échantillon : 4" Vide : 10-8 mbar Porte échantillon tournant Support pour fibres optiques	Au, Cr, Ti, Ni, Al, Cu, Ag, Pd, Fe, Ge
Evaporateur thermique ou pulvérisation cathodique (DC) Plassys MEP 300	Taille échantillon : 2" Vide : 10-7 mbar Porte échantillon chauffant	Au, Cu, Cr Gaz plasma : Ar, N2
Evaporateur thermique ou par faisceau d'électrons, canon à ions Elektorava	Taille échantillon : 4" Vide : 10-8 mbar Porte échantillon chauffant tournant Porte échantillon refroidi	Tous métaux (Au, Cr, Ti, Ni, Al...) Oxydes Canon à ions : Ar, N2, O2
Pulvérisation cathodique (DC et RF) Plassys MP 300	Taille échantillon : 2" Vide : 10-7 mbar Porte échantillon chauffant	Ti, SiO2, ITO, Ta, Ag, Cu Gaz plasma : O2, Ar, N2
Gravure ionique réactive Oxford PLASMALAB SYSTEM100	Taille échantillon : 2" Vide : 10-7 mbar Porte échantillon thermostaté (0-80°C)	Gravure chimique Gravure physique Gaz: Ar, O2, N2, SF6, CF4

UN CENTRE DÉDIÉ À LA NANOFABRICATION

Les équipements d'élaboration et de caractérisation sont mis à disposition dans le cadre de projets nationaux et européens, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté scientifique (centres de recherche publics et privés, laboratoires universitaires, entreprises privés, SATT...) par le biais de prestations de service ou de droits d'accès après formation.

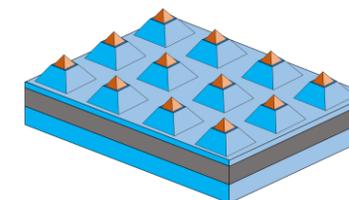
Principe de la micro-fabrication par lithographie



Ces équipements sont répartis en 3 pôles : Couches minces, Lithographies et Gravures, Caractérisations Nanofab

Pour plus de détails:

<https://icb.u-bourgogne.fr/centre-de-nanofabrication-cnff/>



CONTACTEZ-NOUS



Nicolas Pocholle
Ingénieur

+33 (0)6 26 39 70 69
nicolas.pocholle@sayens.fr